MANUFACTURE OF COMPLEMENTARY THIN-FILM TRANSISTOR

Patent Number:

JP63296379

Publication date:

1988-12-02

Inventor(s):

SATO HIROYA; others: 02

Applicant(s):

SHARP CORP

Requested Patent:

☐ JP63296379

Application Number: JP19870132251 19870528

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L29/78; H01L27/12

EC Classification:

Equivalents:

JP1878476C, JP6005753B

Abstract

PURPOSE: To enable a high-speed operation by a method wherein a specified thickness is retained of a silicon oxide film just on a polycrystalline silicon layer to be converted into a gate and this process is followed by a process wherein steps are taken so that the gate may not be affected by impurity to be implanted into a source and drain for a reduction in gat electrode resistance.

CONSTITUTION: The thickness of a silicon oxide film 1 remaining on a gate electrode 5 will be so designed that n-type and p-type impurity ions to be implanted in the next process will hardly reach the gate electrode 5. It follows therefore that, in the implantation process of the n-type and p-type impurity ions for the formation of a source and drain regions just after the gate pattern formation process, the ions will be prevented from landing into the gate polycrystalline silicon 5. In this way, the gate is protected from impurity ions that may otherwise cause an complementary increase in its resistance. The silicon oxide film 4 will not be an obstacle in a hydrogenation process because hydrogen penetrates it easily, which allows a gate film to be formed thick. In this way, side walls may be formed, which contributes to an increase in the element operating speed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(9日本国特許庁(JP)

⑪特許出顋公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 196379

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)8月15日

B 24 C 3/06 11/38 A 47 L B 24 C 9/00 A-6634-3C 6420-3B H-6634-3C

審査請求 未請求 発明の数 3 (全5頁)

❷発明の名称

研掃材飛散防止方法及び装置

基

願 昭62-27187 御特

夫

昭62(1987)2月10日 23出 阋

者 松。 居 ⑫発 明

大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地 大阪瓦斯株式会社

郷 73条 眀 者 本

進

大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地 大阪瓦斯株式会社

内

隆 7 明 者 永 松

兵庫県加古郡播磨町新島8番地 川崎重工業株式会社播磨

工場内

広 3発 明 者 谷 译

兵庫県加古郡播磨町新島8番地 川重工事株式会社西部支

社内

大阪瓦斯株式会社 ①出 願 人

川崎重工業株式会社 の出 頭 人

20代 理 人 弁理士 富田 大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地

兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号

1. 発明の名称

胡掃材飛散防止方法及び装置

2. 特許請求の範囲

(1) 建造物壁面に粒状研掃材をプラストして表 面処理を行うに際し該プラスト後の研掃材を吸引 捕集するようにした研開材飛散防止方法において、 上記研撓材のプラストと吸引抓集との間で上記壁 面に当接状態の所定幅のロータリープラシに回転 と振動を付与して研開材を強制的に吸引捕集に与 るようにしたことを特徴とする研探材飛散防止方

(2) 建造物壁面に粒状研掃材をプラストして表 面処理を行うに際し該プラスト後の研探材を吸引 捕集するようにした研網材飛散防止方法において、 上記研掃材のプラストと吸引捕集との間で上記壁 面に当接状態の所定幅のロータリープラシに回転 と振動を付与して研掃材を強制的に吸引捕集に与 るようにし、併せて壁面に沿って逸散する研構材 を磁石により吸着捕集するようにしたことを特徴

とする研帯材飛散防止方法。

(3)建造物壁面に対向して移動自在に設置され るフード内上部に研開材頃射ノズルが壁面に向け て斜設され下部に研婚材に対する吸引回収ダクト が開口して設置されている研掃材飛散防止装置に おいて、該フード用の噴射ノズルと吸引回収ダク トとの間にあって壁面に当接する所定幅のロータ リープラシが回転装費と振動装置に遊係されてい ることを特徴とする研帯材飛散防止装體。

3. 発明の詳細な説明

〈産衆上の利用分野〉

開示技術はビルや鉄塔等の建造物の壁面に外装 材としての塗料を塗布するに際し、その壁面を塗 装し易いように表面処理する技術分野に属する。 〈要旨の概要〉

而して、この出願の発明はビルや鉄骨構造物等 の建造物の壁面に見栄えが良く、耐久性良く塗装。 を施すに際して鉄粒等の粒状研構材を噴射ノズル から激しくプラストして表面処理を行い、プラス ト楼の研掲材については吸引回収ダクト等により

吸引捕集して再利用するようにするプロセスでの研開材积散防止方法と該方法に直接使用する装置に関する発明であり、特に、噴射ノズルと吸引回収がクトの間に於いてフード内に堅面に当接がいて、大力に回転と振動とを付与し、壁面に反射する研開材を確実に吸引回収分トにより取引捕集するようにした研開材形別にある。

〈従来技術〉

れ、フィードバックパイプ14を介してエジェクタ 10に逆送されて再利用するようにされている。 〈発明が解決しようとする問題点〉

したがって、壁面の被処理面に形成されている 微小の凹凸部位や溶接ピード等の変形部分にゴム シール 8が追従出来ないような場合には大量の研 排材12が飛散するという不都合さがあった。 介しての所謂パワーツール法と、圧縮空気を利用して鉄粒等の研掃材を壁面に噴出させるプラスト法の技術があるが、一般的には処理面の仕上り品質や作業能率、機械化による自動化等の点でプラスト法がパワーツール法より優れた手段として広く採用されるようになってきている。

したがって、フード 6は作集中に研探材12の系外への飛散を確実に阻止するには不充分であるという点から完全に実用化され得ないきらいがあった。

〈発明の目的〉

く問題点を解決するための手段・作用〉

上述目的に沿い先述特許請求の範囲を要旨とするこの出願の発明の構成は前述問題点を解決する ために、ビルや鉄骨構造物等の建造物の壁面の微

小凹凸溶接ビードや溶接歪等を滑かにするように 表面処理を行うに際して研掃材釈放防止装置を壁 面の表面処理部に当接させ、そのフードの開口部 がゴムシールを介して密碧、且つ、移動自在にし、 内部に設けた噴射ノズルより研開材を高速で噴射 させて被処理部分に衝突させプラストを行い、ア ラスト後の研掃材はフード内底部に設けた吸引回 収ダクトにより塵埃と共に捕集されて研探材は再 び噴射ノズルより噴出するようにし、而して、こ の間、フード内に於いては壁面に当接すると共に 回転装置により回転し、更に、振動装置により所 定の往復振動を行われてフードの開口部から逸散 しようとする衝突後反射する研探材を強制的に受 皿部分に送給して吸引捕集するようにし、系外へ の飛散を防止し、更には、不測にしてフードの開 口部よりリークして壁面に沿って下降しようとす る研掃材はフレームに設けた磁石により吸着され て作業環境に逸散することがないようにした技術 的手段を講じたものである。

〈実施例一構成〉

に供されるようにされている。

而して、噴射ノズル 6の開口部 7近傍には、第 2 図に示す様に(第1 図に於いては図示の都合上 その機構部の一部しか示されていないが)パー状 のフレーム15がスプリング16、16…を介して立体 的に揺動自在に付設されており、その内部には各 々ペアリング18、18…を介して両側に一対の、又、 図上下側に1つのロータリーブラシ17、17、17が 三基設けられている。

該各ロータリープラシ17は鋼線等を放射状に回転軸に多数植設して轄円筒状の設定幅に形成されたものであり、両側のロータリープラシ17、17はフレーム15に設けられた1つの回転装置のモータ19によりミッション20を介して回転するようにされており、下側のロータリープラシ17はフレーム15の一側寄りに設けられたモータ19′によりミッション20′を介して回転されるようにされている。

又、モータ19'の反対側には周知の適宜の振動 装置21が設けられて、フレーム15の左右のパラン スがモータ19'ととれるようにされている。 次に、この出願の発明の1実施例を第1~3図を参照して説明すれば以下の通りである。尚、第4図と同一思様部分は同一符号を用いて説明するものとする。

又、フード 6の下側の受皿部分 6' には開口部 に対向して設けられた吸引回収ダクト13が固設されてフィードバックパイプ14を介しプラスト後の 研探材12を吸引捕集してエジェクタ10より再利用

そして、第1図に示す様にフレーム15は壁面 5の上下方向に沿って所定に振動し、又、ロータリープラシ17、17、17は壁面 5の被処理面に軽く当接されて矢印に示す様に回転されるようにされている。

く実施例ー作用)

上述構成の研掃材飛散防止装置 1'により壁面 5の塗装前の表面処理を行うに際し、ローラ 3、3を介して研掃材飛散防止装置 1'を壁面 5の被処理面に当接させ、矢印に示す様に図上下側から上側に移動させ、各モータ19、19'、及び、振動装置21を作動させると、上方に移動する研掃材飛散防止装置 1'のフード 6内に於いて各ロータリーブラシ17、17、17は矢印に示す様に回転しながら装置に対しその内部に於いて所定ストロークで矢印に示す様に上下動の振動をする。

そして、その間、エジェクタ10によりフィード パイプ11から空気輸送されてくる研掃材12は高速 で噴射ノズル 9から噴射されて壁面 5の被処理而 に衝突し、反射された研掃材12はフード 6内下部 ・の受皿部 6′ に至り、回収ダクト13の開口部から 吸引捕集されてフィードバックパイプ14を軽てエ ジェクタ10より噴射ノズル 9を介し再び噴射する ように利用される。

そして、所定速度で回転すると共に、上下方向に振動する各ロータリープラシ17の鋼線は壁面の被処理面に衝突して飛散しようとする研掃材の鉄粒に対しこれを捕捉して強制的に受皿部 6′の吸引回収ダクト13の開口部に送給する。

したがって、反射された後の研掲材12は受血部 6'で確実に吸引回収ダクト13により吸引捕集することが出来る。

尚、不測にしてゴムシール 8から壁面 5に沿って逸出する研掃材12は開口部 7の周囲に(当該実施例では研掃材飛散防止装置 1'が矢印方向に上部に移動するので、開口部 7の上下部分にのみ)設けられた磁石22、22に吸着捕捉されて作業環境に飛散逸散することはない。

又、必要に応じて研開材飛散防止装置 1'を方 向転換して移動する際には、上述実施例と実質的

と送給して系外に飛散しないようするという効果 が奏される。

したがって、フード内に於いても、フードの間口部に設けられたゴムシール等への衝突が避けられ、ゴムシールを損傷することがなく、装置全体の耐久性を向上することが出来、作衆環境を悪化させないという優れた効果が奏される。

而して、フード内に設けられたロータリープラシを回転すると共に、所定方向に振動するようにしたことにより、回転するロータリープラシの網線等の研究後の研探材のあらゆる方向のものに対してこれを強制的に扱き取り、又、巻きるように入るしているとが出来が奏される。

又、装置としては、フード内にロータリーブラシを回転装置と振動装置に連結されていることにより、装置全体としてはフード内のロータリーブラシ、及び、その駆動装置のみであるために、特

に作用効果は変わりはないものである。

尚、この出願の発明の実施態様は上述実施例に限るものでないことは勿論であり、例えば、振動についてはフード毎行うようにしたり、進行方向上側の開口部にロータリープラシを付けたりする等種々の態様が採用可能である。

そして、設計変更的には随石は電磁石にしたり する等出来ることも又勿論のことである。 〈発明の効果〉

別にサイズは大きくならずコンパクト化され、フード内の容積部分を有効利用することにより、操作については在来態様同様と何ら支障なく行われるものである効果がある。

そして、ロータリープラシと駆動装置はフードの開口部分に設けられているために、重心が後側に片寄らず、装置を支持する機構についても何ら影響はないという利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1~3図はこの出願の発明の1実施例の説明図であり、第1図は部分断面側面図、第2図は第1図Ⅱの正部拡大部分断面拡大側面図、第4図は従来技術に基づく研掃材飛取装置の部分断面側面図である。

5…壁面、 12…研掃材、

17…ロータリープラシ、 22…磁石、

6…フード、 9…噴射ノズル、

13…吸引回収ダクト、

1′…研掃材飛散防止装置、 20…回転装置、

出願人 大阪瓦斯株式会社 川崎重工業株式会社

代理人 富田 幸 春





